

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

Наименование образовательной программы: Нанотехнология в электронике

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Физические основы полупроводниковых наноматериалов**

**Москва
2023**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Холодный Д.С.
	Идентификатор	R0bac9dac-KholodnyDS-6393810d

(подпись)

Д.С.

Холодный

(расшифровка
подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

(должность, ученая степень,
ученое звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Холодный Д.С.
	Идентификатор	R0bac9dac-KholodnyDS-6393810d

(подпись)

Д.С.

Холодный

(расшифровка
подписи)

Заведующий
выпускающей кафедры

(должность, ученая степень,
ученое звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Славинский А.З.
	Идентификатор	R99b3b9ab-SlavinskyAZ-c08f5214

(подпись)

А.З.

Славинский

(расшифровка
подписи)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-3 Способен участвовать в проведении технологических процессов изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники

ИД-1 Знает базовые технологические процессы изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники

ИД-2 Знает об физико-химических основах 9 технологических процессов изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники

2. ПК-8 способен осуществлять организацию и проведение экспериментальных работ по отработке и внедрению новых материалов, технологических процессов и оборудования производства изделий микроэлектроники

ИД-5 Заключение о целесообразности внедрения новых технологических процессов производства изделий микроэлектроники и оборудования на основании экспериментальных данных

ИД-6 Анализ влияния параметров и режимов технологических операций производства изделий микроэлектроники на параметры качества опытных образцов изделий микроэлектроники

ИД-7 Анализ и определение причин отклонения параметров технологических операций производства изделий микроэлектроники от заданных

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Компьютерное задание

1. КМ-5 Контрольная работа № 1 Построение элементарной ячейки и расчет межатомных расстояний для наиболее часто используемых полупроводниковых и оксидных кристаллов. (Контрольная работа)

2. КМ-7 Контрольная работа № 3 Энергетические уровни примесных ионов в оксидных кристаллах. Квантовые числа. (Контрольная работа)

Форма реализации: Письменная работа

1. КМ-1 Тест № 1. Геометрические пределы устойчивости структур с различными координационными числами (Тестирование)

2. КМ-2. Тест № 2. Физико-математические основы диффузии. (Контрольная работа)

3. КМ-3 Тест № 3. Квантовые числа и обозначение энергетических уровней. (Контрольная работа)

4. КМ-4 Тест № 4. Квантовые ямы и сверхрешетки. (Контрольная работа)

5. КМ-6 Контрольная работа № 2 Твердотельные химические реакции. Решение уравнения диффузии в присутствии химических реакций. (Проверочная работа)

БРС дисциплины

5 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %							
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4	КМ-5	КМ-6	КМ-7
	Срок КМ:	2	4	6	8	10	12	14
(1) Основные понятия нанoeлектроники								
(1) Основные понятия нанoeлектроники	+							
(2) Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения								
(2) Конденсированная среда, дислокации, атомное и молекулярное упорядочения			+					
(3) Распространенные виды кристаллографических решеток, самоорганизация в твердых телах								
(3) Распространенные виды кристаллографических решеток, самоорганизация в твердых телах				+				
(4) Связь электроники и квантовой физики, простейшие виды низкоразмерных объектов								
(4) Связь электроники и квантовой физики, простейшие виды низкоразмерных объектов					+			
(5) Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц								
(5) Особенности структуры и свойств, связанные с малым размером частиц						+		
(6) Микроструктура и свойства нано кристаллических материалов, нано керамика и нано композиты								
(6) Микроструктура и свойства нано кристаллических материалов, нано керамика и нано композиты							+	
(7) Поверхностные явления								
(7) Поверхностные явления								+
(8) Энтропия в неупорядоченных системах								
(8) Энтропия в неупорядоченных системах								+
Вес КМ:		15	15	15	15	10	15	15

\$Общая часть/Для промежуточной аттестации\$

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ПК-3	ИД-1 _{ПК-3} Знает базовые технологические процессы изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники	Знать: 1 влияние состава на свойства наноматериалов; Уметь: 1 рассчитывать теплофизические характеристики полупроводниковых наноматериалов для различных областей их использования	Км-1 Тест № 1. Геометрические пределы устойчивости структур с различными координационными числами (Тестирование) КМ-4 Тест № 4. Квантовые ямы и сверхрешётки. (Контрольная работа)
ПК-3	ИД-2 _{ПК-3} Знает об физико-химических основах 9 технологических процессов изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники	Знать: 6 влияние размеров кластеров на свойства наноматериалов; Уметь: 6 рассчитывать механические характеристики полупроводниковых наноматериалов для различных областей их использования	Км-1 Тест № 1. Геометрические пределы устойчивости структур с различными координационными числами (Тестирование) КМ-5 Контрольная работа № 1 Построение элементарной ячейки и расчет межатомных расстояний для наиболее часто используемых полупроводниковых и оксидных кристаллов. (Контрольная работа)
ПК-8	ИД-5 _{ПК-8} Заключение о целесообразности внедрения новых технологических	Знать: 7 классификацию наноматериалов Уметь:	КМ-2. Тест № 2. Физико-математические основы диффузии. (Контрольная работа) КМ-5 Контрольная работа № 1 Построение элементарной ячейки и расчет межатомных расстояний для наиболее часто используемых

	процессов производства изделий микроэлектроники и оборудования на основании экспериментальных данных	7 анализировать топохимические реакции при создании наноматериалов	полупроводниковых и оксидных кристаллов. (Контрольная работа)
ПК-8	ИД-6 _{ПК-8} Анализ влияния параметров и режимов технологических операций производства изделий микроэлектроники на параметры качества опытных образцов изделий микроэлектроники	Знать: 2 влияние структурных характеристик на свойства наноматериалов; Уметь: 2 интерпретировать электрофизические характеристики полупроводниковых и диэлектрических наноматериалов	КМ-2. Тест № 2. Физико-математические основы диффузии. (Контрольная работа) КМ-6 Контрольная работа № 2 Твердотельные химические реакции. Решение уравнения диффузии в присутствии химических реакций. (Проверочная работа)
ПК-8	ИД-7 _{ПК-8} Анализ и определение причин отклонения параметров технологических операций производства изделий микроэлектроники от заданных	Знать: 3 закономерности структурообразования, фазовые превращения в наноматериалах Уметь: 3 рассчитывать электрические характеристики полупроводниковых наноматериалов для различных областей их использования	КМ-3 Тест № 3. Квантовые числа и обозначение энергетических уровней. (Контрольная работа) КМ-7 Контрольная работа № 3 Энергетические уровни примесных ионов в оксидных кристаллах. Квантовые числа. (Контрольная работа)

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. КМ-1 Тест № 1. Геометрические пределы устойчивости структур с различными координационными числами

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Тест № 1. Геометрические пределы устойчивости структур с различными координационными числами

Краткое содержание задания:

КМ-1. Тест № 1. Геометрические пределы устойчивости структур с различными координационными числами

Контрольные вопросы/задания:

Знать: 1 влияние состава на свойства наноматериалов;	1.КМ-1 Знать 2. Условная классификация материалов по размеру D частиц (зёрен).. 2.КМ-1 Знать 3. Многослойные наноструктуры: квантовые ямы, сверхрешётки..
Знать: 6 влияние размеров кластеров на свойства наноматериалов;	1.КМ-1 Знать 1.. Основные понятия нанoeлектроники..

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 80

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-2. КМ-2. Тест № 2. Физико-математические основы диффузии.

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Тест № 2. Физико-математические основы диффузии.

Краткое содержание задания:

Тест № 2. Физико-математические основы диффузии.

Контрольные вопросы/задания:

Знать: 7 классификацию наноматериалов	1.КМ-2 Знать 2. Типы Дислокации в кристаллах. Несовершенные дислокации. Дефекты упаковки и двойники. 2.КМ-2 Знать 3. Динамические свойства: общие особенности, неустойчивости. Неустойчивости в изначально бездефектных кристаллических частицах..
Знать: 2 влияние структурных характеристик на свойства наноматериалов;	1.КМ-2 Знать 1. Типы Дислокации в твердых телах.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-3. КМ-3 Тест № 3. Квантовые числа и обозначение энергетических уровней.

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Тест № 3. Квантовые числа и обозначение энергетических уровней.

Краткое содержание задания:

Тест № 3. Квантовые числа и обозначение энергетических уровней

Контрольные вопросы/задания:

Знать: 3 закономерности структурообразования, фазовые превращения в наноматериалах	1.КМ-3 Знать 1. Распространенные виды кристаллографических решеток, самоорганизация в твердых телах. 2.КМ-3 Знать 3. Метод изображения кристаллических структур шарами разных размеров.
--	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60
Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50
Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-4. КМ-4 Тест № 4. Квантовые ямы и сверхрешётки.

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Тест № 4. Квантовые ямы и сверхрешётки.

Краткое содержание задания:

Тест № 4. Квантовые ямы и сверхрешётки.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: 1 рассчитывать теплофизические характеристики полупроводниковых наноматериалов для различных областей их использования	1.КМ-4 Уметь 1. Выстраивать схемы механизмов гетероэпитаксиального роста пленок. 2.КМ-4 Уметь 2. Анализировать квантово размерные эффекты. 3.КМ-4 Уметь 3. Выстраивать изображения атомных и молекулярных орбиталей.
---	---

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70
Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60
Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50
Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-5. КМ-5 Контрольная работа № 1 Построение элементарной ячейки и расчет межатомных расстояний для наиболее часто используемых полупроводниковых и оксидных кристаллов.

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 10

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольная работа № 1 Построение элементарной ячейки и расчет межатомных расстояний для наиболее часто используемых полупроводниковых и оксидных кристаллов.

Краткое содержание задания:

Контрольная работа № 1 Построение элементарной ячейки и расчет межатомных расстояний для наиболее часто используемых полупроводниковых и оксидных кристаллов.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: 6 рассчитывать механические характеристики полупроводниковых наноматериалов для различных областей их использования	1.КМ-5 Уметь 1. Анализировать фазовые диаграммы диспергированных систем. 2.КМ-5 Уметь 2. Анализировать фазовые диаграммы диспергированных систем..
Уметь: 7 анализировать топохимические реакции при создании наноматериалов	1.КМ-5 Уметь 3. Анализировать структуру поверхности.

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-6. КМ-6 Контрольная работа № 2 Твердотельные химические реакции.**Решение уравнения диффузии в присутствии химических реакций.**

Формы реализации: Письменная работа

Тип контрольного мероприятия: Проверочная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольная работа № 2 Твердотельные химические реакции. Решение уравнения диффузии в присутствии химических реакций.

Краткое содержание задания:

Контрольная работа № 2 Твердотельные химические реакции. Решение уравнения диффузии в присутствии химических реакций.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: 2 интерпретировать электрофизические характеристики полупроводниковых и диэлектрических наноматериалов	1.КМ-6 Уметь 1. Анализировать микроструктуру и свойства нанокристаллических материалов. 2.КМ-6 Уметь 2. Выстраивать изображения границ разделов в наноматериалах. 3.КМ-6 Уметь 3. Анализировать особенности структуры субмикроструктурных металлов.
---	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

КМ-7. КМ-7 Контрольная работа № 3 Энергетические уровни примесных ионов в оксидных кристаллах. Квантовые числа.

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 15

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольная работа № 3 Энергетические уровни примесных ионов в оксидных кристаллах. Квантовые числа.

Краткое содержание задания:

Контрольная работа № 3 Энергетические уровни примесных ионов в оксидных кристаллах. Квантовые числа.

Контрольные вопросы/задания:

Уметь: 3 рассчитывать электрические характеристики полупроводниковых наноматериалов для различных областей их использования	1.КМ-7 Уметь 1. Анализировать поверхностное натяжение и термодинамика плоских границ раздела.. 2.КМ-7 Уметь 3. Анализировать твердофазные топохимические реакции.
---	--

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5 семестр

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Пример билета

Экзаменационный билет № 1.

- 1) Понятие о потенциальных ямах и барьерах. Микрочастица в прямоугольной потенциальной яме.
- 2) Физико-математические основы диффузии.
- 3) Термодинамические аспекты поверхности. Структура поверхности и межфазных границ

Процедура проведения

ответ устный по написанным билетам.

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-1пк-3 Знает базовые технологические процессы изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники

Вопросы, задания

1.Экзаменационный билет № 2.

- 1) Применение зонной теории к квантовым ямам и сверхрешеткам.
- 2) Типы полупроводников. Элементарные полупроводники. Бинарные соединения. Окислы. Слоистые полупроводники. Разнообразие полупроводников.
- 3) Эмпирические потенциалы взаимодействия

Материалы для проверки остаточных знаний

1.Вопрос 1. Структура границ зёрен в НС материале при заданной температуре сложным образом зависит от целого ряда переменных:

Ответы:

1. кристаллографических параметров, описывающих взаимную ориентацию двух кристаллов и границы раздела между ними;
2. химического состава границы, или иными словами, природы и распределения адсорбированных атомов;
3. потенциала взаимодействия между атомами;
4. природы атомной релаксации, в результате которой достигается расположение атомов с минимальной свободной энергией упругих и концентрационных возмущений в направлении перпендикулярном границе.

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 1. Правильный ответ все варианты.

2.Вопрос 2. Границы раздела компактированных нанокристаллических материалов могут содержать три типа дефектов:

Ответы:

- 1) отдельные вакансии;
- 2) вакансионные агломераты, или нанопоры, образующиеся в тройных стыках кристаллов;
- 3) большие поры на месте отсутствующих кристаллитов;
- 4) междоузельные атомы.Остаточные знания Вопрос 2. Ответ 2 а) содержание ответа

Остаточные знания Вопрос 2. Ответ 2 б) содержание ответа

Остаточные знания Вопрос 2. Ответ 2 в) содержание ответа

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 2. Правильный ответ все варианты.

2. Компетенция/Индикатор: ИД-2ПК-3 Знает об физико-химических основах 9 технологических процессов изготовления материалов электронной техники, микро- и нанoeлектроники

Вопросы, задания

1. Экзаменационный билет № 3.

- 1) Применение теории перколяции к полупроводникам.
- 2) Фрактальный анализ самоорганизованных полупроводниковых структур.
- 3) Твердотельные химические реакции.

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Вопрос 3. Нанопористые микрочастицы на основе кремния — это пористые кремниевые частицы:

Ответы:

- 1) из некристаллического SiO_2 ;
- 2) из синтетического кремния;
- 3) с размером от 1 до 100 нм;
- 4) содержащие тысячи одинаковых нанопор.

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 3. Правильный ответ 2), 3)

2. Вопрос 4. Что представляют собой наноматериалы?

Ответы:

- 1) Наноматериалы, содержащие наноразмерные структурные элементы, называются наноструктурными материалами.
- 2) с размером от 1 до 100 нм;

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 4. Правильный ответ 2).

3. Компетенция/Индикатор: ИД-5ПК-8 Заключение о целесообразности внедрения новых технологических процессов производства изделий микроэлектроники и оборудования на основании экспериментальных данных

Вопросы, задания

1. Экзаменационный билет № 6.

- 1) Основные представления квантовой механики. Квантовая модель атома.
- 2) Зависимость размеров атомов и ионов от координационных чисел
- 3) Метод изображения кристаллических структур шарами разных размеров. Координационные числа. Типы полиэдров. Геометрические пределы устойчивости структур с различными координационными числами.

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Вопрос 5. Среди наноматериалов можно выделить несколько основных разновидностей.

Ответы:

- 1) консолидированные наноматериалы;
- 2) нанополупроводники;
- 3) нанополимеры;
- 4) нанобиоматериалы;
- 5) фуллерены и тубулярные наноструктуры;
- 6) катализаторы;
- 7) нанопористые материалы;

8) супрамолекулярные структуры.

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 5. Правильный ответ все 8 видов.

2.Вопрос 6. Классификация консолидированных наноматериалов по составу фаз, распределению и форме структурных составляющих.

Ответы:

- 1) Пластинчатая
- 2) Столбчатая
- 3) Равноосная
- 4) Чешуйчатая
- 5) Сферическая
- 6) эллиптическая

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 6. Правильный ответ 1), 2), 3)

4. Компетенция/Индикатор: ИД-6ПК-8 Анализ влияния параметров и режимов технологических операций производства изделий микроэлектроники на параметры качества опытных образцов изделий микроэлектроники

Вопросы, задания

1.Экзаменационный билет № 5.

- 1) Эффективные радиусы ионов.
- 2) Атомные и молекулярные орбитали.
- 3) Профили концентрации и температуры. Распределение Гаусса. Функция ошибок или Erf-функция.

Материалы для проверки остаточных знаний

1.Остаточные знания. **Вопрос 7.** Основные методы получения консолидированных наноматериалов.

Ответы:

- 1) Порошковая технология
- 2) Интенсивная пластическая деформация
- 3) Контролируемая кристаллизация из аморфного состояния
- 4) Технология пленок и покрытий

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 7. Правильный ответ все 4 варианта.

2.Вопрос 8. Основные типы макромолекулярной линейной архитектуры.

Ответы:

- 1) Гибкий клубок
- 2) Жесткий стержень
- 3) Линейный цикл
- 4) Полиротаксан

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 8. Правильный ответ все 4 варианта.

5. Компетенция/Индикатор: ИД-7ПК-8 Анализ и определение причин отклонения параметров технологических операций производства изделий микроэлектроники от заданных

Вопросы, задания

1.Экзаменационный билет № .4

- 1) Термодинамические аспекты поверхности. Структура поверхности и межфазных границ.
- 2) Центральные и направленные силы между атомами. Силы между молекулами.
- 3) Атомные и молекулярные орбитали.

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Вопрос 9. Основные типы макромолекулярной архитектуры.

Ответы:

- 1) Линейный
- 2) Разветвленный
- 3) Сшитый
- 4) Дендример

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 9. Правильный ответ все 4 варианта .

2. Вопрос 10. ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ..

Ответы:

- 1) Температурная зависимость электросопротивления увеличивается
- 2) Температурная зависимость электросопротивления не меняется
- 3) Температурная зависимость электросопротивления спадает

Верный ответ: Остаточные знания. Вопрос 10. Правильный ответ 3) .

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5

Нижний порог выполнения задания в процентах: 70

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3

Нижний порог выполнения задания в процентах: 50

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу